

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.³
C07D 333/50

(11) 공개번호 특1984-0005440
(43) 공개일자 1984년11월12일

(21) 출원번호	특1983-0003066
(22) 출원일자	1983년07월05일
(30) 우선권주장	4117 1982년07월06일 스위스(CH)
(71) 출원인	에프. 호프만-라 루트 앤드 캄파니 아크티엔게젤샤프트 이, 마인라트 슈미트 스위스연방 바젤 그렌자헤르 스트라세 124-184
(72) 발명자	마이클 클라우스
(74) 대리인	독일연방공화국 바일/라인 7858, 암 헬렌라인 6 이병호, 감성기

심사청구 : 없음

(54) 헤테로사이클릭 화합물의 제조방법

요약

내용 없음

명세서

[발명의 명칭]

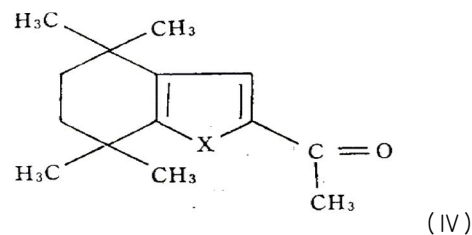
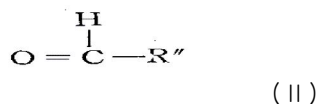
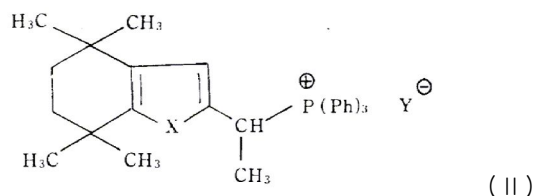
헤테로사이클릭 화합물의 제조방법

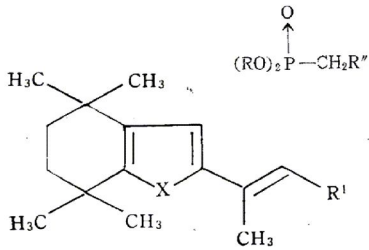
본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

일반식(II)화합물을 일반식(III)화합물과 반응시키거나, 일반식(IV)화합물을 일반식(V)화합물과 반응시키고, 경우에 따라, 생성된 카복실산 에스테르를 비누화하거나, 아마이드로 전환시키거나, 또는 알콜로 환원시키며, 경우에 따라, 상술한 알콜을 에테르화하거나 포르밀 화합물로 산화시키고, 또는 생성된 카복실산을 염으로 전환시킴을 특징으로하여 일반식(I)화합물 및 그의 염을 제조하는 방법.





(V)

상기식에서, X는 $-\text{CH}=\text{CH}-$, $-\text{O}-$ 또는 $-\text{S}-$ 이며; R^1 은 그룹 $\text{Ar}-\text{R}^2$ 또는 $-\text{CH}=\text{CH}-\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}-\text{R}^{21}$ 이고; Ar은 페닐, 피리딜, 푸릴 또는 티에닐이며; R^2 는 그룹 $-\text{CO}_2\text{R}^3$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^4$, $-\text{CH}_2\text{OR}^3$ 저급-알킬설포닐 또는 포리말이고; R^{21} 은 그룹 $-(\text{O}_2\text{R}^3, -((\text{O})\text{R}^4, -\text{CH}_2\text{OR}^3$ 또는 포리말이며, R^3 은 수소 또는 저급-알킬이고; R^4 는 수소, 하이드록시, 아미노, 저급-알킬아미노, 디-(저급-알킬)아미노 또는 저급-알킬이며; 분자중 적어도 한개의 환은 헤테로사이클이고; R은 저급 알콕시를 나타내며; Ph는 페닐을 나타내고; R^{11} 은 그룹 $-\text{ArCO}_2\text{R}^3$, $-\text{ArSO}_2-$ 저급-알킬 또는 $-\text{CH}=\text{CH}-\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CHCO}_2\text{R}^3$ 를 나타내며; Y^\ominus 은 무기 또는 유기산의 음이온이다.

청구항 2

제1항에 있어서, X가 $-\text{S}-$ 또는 $-\text{O}-$ 인 일반식(I)화합물을 제조하는 방법.

청구항 3

제1항에 있어서, R^1 이 그룹 $\text{Ar}-\text{R}^2$ (여기에서 Ar은 페닐 또는 피리딜이다)인 일반식(I)화합물을 제조하는 방법.

청구항 4

제1항에 있어서, R^2 가 저급-알콕시 카보닐인 일반식(I)화합물을 제조하는 방법.

청구항 5

제1항에 있어서, 에틸 p-[2-(4,5,6,7-테트라하이드로-4,4,7,7-테트라메틸-벤조[b]티엔-2-일)프로페닐]벤조에이트를 제조하는 방법.

청구항 6

제1항에 있어서, 에틸 6-[(E)-2-(4,5,6,7-테트라하이드로-4,4,7,7-테트라메틸-벤조-[b]티엔-2-일)프로페닐]니코네이트를 제조하는 방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.